## Entregable

Ejercicio 1 - 5: consideramos un transictor NMOS Pabricado sobre Si tal que el óxido de la puesta tiene un espesor de 15nm. El óxido de puerta es SiO2 con Er = 3,9. La movilidad de e en el canal es µn = 550 cm². La relación entre la anchura y No longitud en W/L = 20. La tensión umbral es VI = 2,3 V. Ademais Eo = 8,854.10 4 F/cm , U = W µn Cox

- a) Determinar el valor de Vos para que el hansistor opere en saluración con Ip=0,2mA.
- b) à Para que rango de la tension Vos el transister operara en las
- validez de la aproximación lineal

En primer lugar Cox es la capacidad de Dxido por unidad de área. Si A es el área del óxido entonces

 $C_{ox} = \frac{C_{pp}}{A}$  Siendo  $C_{pp}$  la capacidad de un condensador de placas plano paralelas con los características del óxido. Esto es  $C_{pp} = \frac{E_r \cdot E_o A}{d} \implies C_{ox} = \frac{E_r \cdot E_o A}{A \cdot d} = \frac{E_r \cdot E_o}{d}.$ 

Por tanto en nuestro probema Cox = 3,9.8,854.10 4 F/cm = 2,30.10 F cm²

a) Para que el transistor opere en saturación, debe haber canal y se tiene que cumplin la condición Vos-Vos Vt

En saturación, la relación entre Ips y Vos viene dada por

Como hay canal Vas > V+ así que despejamos Vas

$$(V_{GS} - V_{+})^{2} = \overline{I}_{DS} 2 \Leftrightarrow V_{GS} = V_{+} + |\overline{ZI_{DS}}| = V_{+} + |\overline{ZI_{DS}}|$$

$$V_{GS} = 2,3V + \sqrt{\frac{2 \cdot 0,2mA}{20 \cdot 550 \frac{cm^2}{V_5} \cdot 2,30 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2}}} = 2,7V$$

b) Para que el transistor opere en saturación, se tiene que verificar la condición VGS > V+ (que haya canal) y que VGS-VpS < VT

Para los dalos de a) VDS > 2,7V-2,3V = 0,4V

c) Si Vos = 20m V => estavemos en la zona lineal si VGS - 20m V > 2,3 V => VGS > 2,32 V

Ahona IDS = K (VGS - VIN) VDS = 20.550 cm² 2,3.10 F (VGS - 2,3V).20mV = VGS · 5,06.10 - 1,1638.104 (Apreximación lineal)

$$I_{DS} = k \left( \left( V_{GS} - V_{Hh} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) = V_{6S} \cdot S_{10} \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{$$

Si sustituimos para el valor

$$V_{GS} = 2,7V$$
 =>  $I_{DS} = 2,02 \cdot 10^{-5} A$  (Aproximación lineal)  
 $I_{DS} = 1,97 \cdot 10^{-5} A$ 

Se prede ver que la aproximación es bastante brenc.

Ejercicio 2 - El transistor está caracterizado por Vi=-3V y K=0,05 A/VZ. Delermina en que región o pera el tansister y calcula Vos, Vos e Jos para:

a) 
$$V_1 = 2V_1 V_2 = 5V$$

b) 
$$V_1 = 3.5 V$$
,  $V_2 = 4V$ 

c) 
$$V_1 = 5V$$
,  $V_2 = 1V$ 

En general, el toransistor esté en conte si Vo > Vr ( > - 1/4 > - 3V => ₩ 4<3V

Si no esté en corte, (V1>3V) enfonces

estava en la zona lineal si VGS - VDS XV7 ⇒ - V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> < V<sub>7</sub> ⇒ V<sub>2</sub> - V<sub>1</sub> <-3V ⇔ V<sub>1</sub> - V<sub>2</sub> > 3V y estava en sativación si VI-Ves 3V.

Por tanto

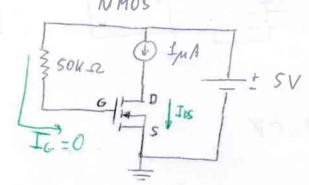
Corte N 1 < 3V Lineal Wis3V y VI-V2>3V Salvencion > V,>3 y V,-V2=3V a) Como V, < 3V => Estumos en corte y VGs = - 2V, VDS = - 5V, IDS = OA

b) Como  $V_1 > 3Vy V_2 - V_2 \le 3V \implies \text{Estamos en salvación y <math>V_{CS} = -35V_1 V_{DS} = -4V_2$   $y \text{ I}_{DS} = \frac{K}{2} \left( V_{GS} - V_{F} \right)^2 = \frac{0.05 \, \text{Az}}{2} \left( -3.544 \, 3V \right)^2 = 6.25 \cdot 10^{-3} \, \text{Az} = 6.25 \, \text{mA}.$ 

c) Como V,>3V y Vi-V2>3V => Estamos en la zona lineal y Vos = -SV, Vps = -1V y

IDS = K (VGS - V+) VDS = OKOS A (-SV+3V)(-1) = 0,1 A

Fjercicio 3.- Paralos circuitos determina en que región opera el transister y los valores de Vas, Vos e Ip para VT = 2,5 V, K=0,01 A V2.



Podemos decirque Jos= 1 pA porque IG=0 y Vos = SV- IG· SOKQ = BV > Vi=2,5V

Podemos suponer, ya que sabemas que el tans istor no está en conte, que está en da zonar lineal.

$$I_{DS} = k \left( V_{GS} - V_{T} \right) V_{DS} \implies V_{DS} = \frac{I_{DS}}{k \left( V_{GS} - V_{T} \right)} = \frac{I_{DL} A}{0.01 \frac{A}{V^{2}} \left( 5 V - 2.5 V \right)} = 4.10^{-5} V \quad \text{gre verifica que}$$

$$V_{GS} - V_{DS} > V_{T} \quad \text{(condición zona lineal)}.$$

Se tiene que 
$$V_A = 12V y V_B = 0V$$

$$V_G = V_R = R_1 \cdot I_{R_1} = R_1 \frac{V_A}{R_1 + R_2} =$$

$$= 12V. \frac{10}{20+10} = 4V$$

Por tunto hay probable mente coinal N

Suponemos que estamos en la zona de saturación y la ecución

$$I_{DS} = \frac{k}{2} \left( V_{GS} - V_{T} \right)^{2} = \frac{0.01 \, A}{2} \left( 4V - J_{DS} 400 \Omega - 2.5V \right)^{2} =$$

$$= 3 \text{ Ins} = \frac{17 \pm \sqrt{92} - 4.800.000125}{2.800} = 7 \pm 3.61$$

Para la solución Ios = 2,12.10=3 A

Si hubieramos supresto la zone lineal

$$\Rightarrow I_{DS} = \frac{121^{1} \pm \sqrt{121^{2} - 4.19200 \cdot 0.18}}{2.19200} = \frac{129 \pm 28.58}{38400}$$

$$= \sqrt{\frac{2.19200}{38400}}$$

$$= \sqrt{\frac{3.99 \cdot 10^{3} A}{100}}$$

$$=$$
  $\begin{cases} = 3, 9 \cdot 10^3 A \end{cases}$ 

Para IDS = 3, 91.103 A

Por temto se verifica la ecvación de la Zona lineal

Como tenemos 2 posibles soluciones coherentes nos pluteamos que la erroner puede ser la de la aproximación lineal.

Si planteumos la ecuación de la zona lineal como

$$I_{DS} = K(V_{GS} - 2, SV)V_{DS} - \frac{KV_{DS}^2}{2}$$
 y sustituinos  $V_{GS} = 4 - 400 I_{DS}$   
 $V_{DS} = 12 - 4800 I_{DS}$ 

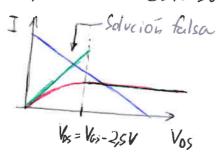
$$= \int I = k(1,5-400I)(12-4800I) - k(12-4800I)^{2} = 19200I^{2}-120I+0.18-115200I^{2}+576I-0.72$$

$$I = \frac{456 \pm \sqrt{456^2 - 4.96000 \cdot 0.54}}{2.96000} = \frac{456 \pm 24}{192000} = \frac{2.5 \cdot 10^3 \text{ A}}{-2.25 \cdot 10^3 \text{ A}}$$

Para Ins = 2,5.10-3A

Para IDS = 2,25.10 A

En efecto, como sos pechabamos la aproximación lineal es mala y hos ofrece una solución que, considerando el comportamiento veal, es imposible. Esto sucede porque



Cuestion 1 - Justifica por qué la corriente de prerta de un MOSFET es prácticamente nula.

El funcionamiento de la puerta es como el de un condensador. Si estamos tratando con un semiconductor de tipo P, al cargar positivamente la zona destalica de la puerta podomos forzar una zona N a través de aplicar un voltaje positivo en la puesta. Cuando esté cargado, al funcionar como un condensador, no va a haber corriente entre la puerta y la zona N que hemos forzado.

Cuestion 2 - Define o explica que es la tensión umbral de un MOSFET.

Es el voltaje que hay que aplicarle a la puerta para que la zona M
que se genera localmente en el semiconductor P esté lan dopado de
e como la zona P de ht. (Análogo para PMOS). (vando el voltaje
aplicado a la puerta est mayor que el voltaje umbral, se forma
unacinal N donde hay corriente de e los e se mueven de Source a
Drain y la corriente electrica tiene el sentido contrario.

(vestion 3.- à Qué cambia en la estructura fisia entre un transister NMOS y un transister PMOS? à y qué cambia en la manera de crear el canal de conducción?

La estructura del NMOS es tal y como se ha descrito en las constiones 1 y 2, es decir, un semiconductor tipo P como exceso de ht, una prerta a la quese le aplica un voltaje positivo mayor que el umbral y la creación de un canal N de e entrentado a la prerta donde hay corriente entre el Drain y el Source.

Análogamente, on un PMOS el semironductor es detipol con except de é, a la puerta se le caplica un voltgie inegativo l'respecto a Source) y si es memor que la tensión umbral se forma un canal P de hveros que van de S a D (igual que la corriente eléctrica).